PAT-NO:

JP02002150944A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002150944 A

TITLE:

LUMINOUS DEVICE HAVING ELECTRON

EMITTER

PUBN-DATE:

May 24, 2002

INVENTOR - INFORMATION:

COUNTRY NAME KUNUGIBARA, TSUTOMU N/AKOMODA, TAKUYA N/A AIZAWA, KOICHI N/ATACHIBANA, KUNIHIDE N/AHASHIGUCHI, SEISHIRO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP2000347200

APPL-DATE: November 14, 2000

INT-CL (IPC): H01J011/02

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a luminous device having electron emitters that can improve luminous efficiency and achieve low electric power consumption and has high stability.

SOLUTION: In the luminous device, a display cell, which has an airtight space, formed between a front-face glass substrate 20 and a rear face glass substrate 11 made of the front face glass substrate 20, rear-face glass

substrate 11 and a pair of neighboring barrier ribs 12 or the like, is

constituted, and electron emitters are arranged in the display cell. The

electron emitter 10 is comprised of a ballistic electron surface emitting type

electron emitter, which comprises a strong field drift layer made of an

oxidized or nitrided porous semiconductor layer between the surface electrode

and the lower electrode, and in which, through the impression of a direct

current voltage between the surface electrode and the lower electrode,

electrons that are filled in the strong field drift layer from the lower

electrode, are emitted passing through the surface electrode.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-150944 (P2002-150944A)

(43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01J 11/02

H 0 1 J 11/02

B 5C040

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特願2000-347200(P2000-347200)

(71)出顧人 000005832

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

(22)出願日

平成12年11月14日(2000.11.14)

(72)発明者 櫟原 勉

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株

式会社内

(72)発明者 菰田 卓哉

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株

式会社内

(74)代理人 100087767

弁理士 西川 惠清 (外1名)

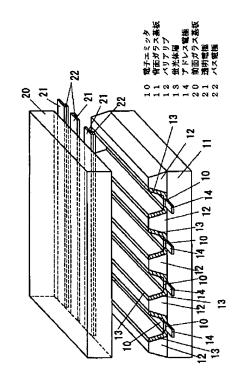
最終頁に続く

(54) [発明の名称] 電子エミッタ付発光装置

(57)【要約】

【課題】発光効率が向上できるとともに低消費電力化が 図れ且つ安定性の高い電子エミッタ付発光装置を提供す る。

【解決手段】前面ガラス基板20、背面ガラス基板1 1、隣り合う一対のバリアリブ12などにより前面ガラ ス基板20と背面ガラス基板11との間に気密空間が形 成された表示セルを構成しており、表示セル内に電子エ ミッタ10が配置されている。電子エミッタ10は、表 面電極と下部電極との間に酸化若しくは窒化した多孔質 半導体層よりなる強電界ドリフト層を有し表面電極と下 部電極との間に直流電圧を印加することにより下部電極 から強電界ドリフト層へ注入された電子が表面電極を通 して放出される弾道電子面放出型の電子エミッタからな る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 気密容器内に封入されたガスの励起に伴う発光を利用する発光装置へ前記ガスを励起させるように前記ガス中へ電子を供給する電子エミッタを付加したものであって、前記電子エミッタが、表面電極と下部電極との間に酸化若しくは窒化した多孔質半導体層よりなる強電界ドリフト層を有し表面電極と下部電極との間に直流の駆動電圧を印加することにより下部電極から強電界ドリフト層へ注入された電子が表面電極を通して放出される弾道電子面放出型の電子エミッタからなることを 10 特徴とする電子エミッタ付発光装置。

【請求項2】 前記ガスは、紫外線を発生するガスからなることを特徴とする請求項1記載の電子エミッタ付発 光装置。

【請求項3】 前記気密容器に設けられた対になる放電 用電極と、当該対になる放電用電極間に直流電圧を印加 して前記気密容器内へ電界を印加する電界印加手段とを 備えることを特徴とする請求項1または請求項2記載の 電子エミッタ付発光装置。

【請求項4】 前記電界印加手段は、前記ガスが放電す 20 る放電開始電圧よりも小さな直流電圧を前記対になる放電用電極間に印加する機能を備えることを特徴とする請求項3記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項5】 前記電子エミッタは、前記放電用電極へ流れる電流を制限するように前記対になる放電用電極間に配置されてなることを特徴とする請求項3記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項6】 前記電子エミッタの前記表面電極と前記下部電極との間へ前記駆動電圧を印加して前記電子エミッタを駆動する駆動手段を備え、駆動手段は、放電開始 30以前から前記電子エミッタを駆動させる機能を有することを特徴とする請求項3記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項7】 前記気密容器に設けられた対になる放電 用電極と、当該対になる放電用電極間に交流電圧を印加 して前記ガスを放電させる電界印加手段と、前記電子エ ミッタの前記表面電極と前記下部電極との間へ前記駆動 電圧を印加して前記電子エミッタを駆動する駆動手段を 備え、駆動手段は、放電開始以前から前記電子エミッタ を駆動させる機能を有することを特徴とする請求項1ま 40 たは請求項2記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項8】 前記電子エミッタは、前記気密容器内に 配設されてなることを特徴とする請求項1ないし請求項 7のいずれかに記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項9】 前記電子エミッタは、前記気密容器の内壁面に配設されてなることを特徴とする請求項8記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項10】 前記電子エミッタの前記表面電極と前 較的大きなMg〇膜からなる保護層で被覆してあるが、 記下部電極との間へ前記駆動電圧を印加して前記電子エ Xeガスに対するMg〇膜の二次電子放出(γ効果)効 ミッタを駆動する駆動手段を備え、駆動手段は、前記電 50 率が0.1%程度と非常に低いため紫外線の発光効率の

2

子エミッタからピークエネルギが3 e V以下若しくは10 e V以上の電子が放出されるように前記電子エミッタを駆動することを特徴とする請求項1ないし請求項9のいずれかに記載の電子エミッタ付発光装置。

【請求項11】 前記駆動手段は、18V以上の駆動電圧で前記電子エミッタを駆動することを特徴とする請求項10記載の電子エミッタ付発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、面状光源、フラットパネルディスプレイパネルなどに応用できる電子エミッタ付発光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のプラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel:以下、PDPと略称する)は、画素に用いられる表示セル(放電セル)に封入されたXeガスを放電させることで励起波長が147nmおよび173nmの紫外線を放出させ、この紫外線によって表示セル内の蛍光体を励起して発光させている。

【0003】しかしながら、この種のPDPの表示セル内での放電は、放電により生じたイオンの二次電子放出で放電が維持される冷陰極グロー放電であるため、電離に必要なエネルギが紫外線の放出に寄与しないので、発光効率が低いという問題がある。また、表示セル内にXeガスのみが封入されたものでは放電効率が低いので、Xeガスに加えてHeガスやNeガスなどを封入したものがあるが、Xeガスの分圧が減少し、発光効率が低下してしまうという問題もあった。さらに、従来のPDPでは表示セル内に封入されたガスが放電を開始するときの電圧である放電開始電圧や、放電を維持するために必要な電圧が高いので、消費電力が大きくなるという問題もあった。これらのことから、PDPでは輝度の向上と消費電力の低減とが望まれている。

【0004】また、直流放電型(DC型)のPDPにおいて256階調などの高い階調が要求されるものでは、駆動時に放電が開始されるまでの時間を1μ秒以内とするとともに、放電に必要な電圧を低減するために表示セルに隣接して補助セルを設けている。しかしながら、補助セルを設けたDC型のPDPでは、製造プロセスの複雑化や発光面積の低下に伴って効率が低下してしまうという問題があった。さらには予備放電によってコントラストが低下するという問題があった。

【0005】一方、交流放電型(AC型)のPDPでは、放電セルの内壁に被着した誘電体層への蓄積電荷を利用して放電に必要な電圧を低減するようにしたものも提案されている。このような誘電体層を放電セルの内壁に設けたPDPでは、誘電体層を二次電子放出係数の比較的大きなMgO膜からなる保護層で被覆してあるが、Xeガスに対するMgO膜の二次電子放出(γ効果)効率が0、1%程度と非常に低いため些射線の発光効率の

向上および低消費電力化に十分な効果が得られないとい う問題があった。また、AC型のPDPでは、壁電荷を 利用しているので、コントラストが低下するという問題 があった。

【0006】また、表示セル内に封入されたガス中へフ ィラメントから電子を供給することでガスの励起効率を 向上させるようにしたものも提案されているが、製造プ ロセスが複雑になるという問題があり、しかも、フィラ メントを用いていることにより、低消費電力化が難しく なるという問題があった。

【0007】そこで、表示セル内にいわゆるスピント (Spindt) 型電極を設置し、スピント型電極からガス中 へ電子を放出することで放電開始電圧を低下させること が考えられている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、表示セル内 に封入されたガスを放電させるためには、パッシェンの 法則によればガス圧を数十kPa程度にすることが必要 である。しかしながら、スピント型電極は、電界がエミ ッタチップの先端に集中するので、エミッタチップの先 20 端の周りの真空度が低くて残留ガスが存在するような場 合、放射された電子によって残留ガスがプラスイオンに イオン化され、プラスイオンがエミッタチップの先端に 衝突するから、エミッタチップの先端がダメージ (例え ば、イオン衝撃による損傷)を受け、仕事関数などが変 動するため、放射される電子の電流密度や効率が不安定 になったり、エミッタチップの寿命が短くなってしまう という問題があった。要するに、スピント型電極は、P DPのように数十kPaのガスが封入された表示セル内 では安定に動作することができず、安定性が低いという 30 問題があった。しかもスピント型電極は製造プロセスが 複雑であるという問題もあった。

【0009】本発明は上記事由に鑑みて為されたもので あり、その目的は、発光効率が向上できるとともに低消 費電力化が図れ且つ安定性の高い電子エミッタ付発光装 置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、上記 目的を達成するために、気密容器内に封入されたガスの 励起に伴う発光を利用する発光装置へ前記ガスを励起さ 40 せるように前記ガス中へ電子を供給する電子エミッタを 付加したものであって、前記電子エミッタが、表面電極 と下部電極との間に酸化若しくは窒化した多孔質半導体 層よりなる強電界ドリフト層を有し表面電極と下部電極 との間に直流の駆動電圧を印加することにより下部電極 から強電界ドリフト層へ注入された電子が表面電極を通 して放出される弾道電子面放出型の電子エミッタからな ることを特徴とするものであり、ガス中へ電子エミッタ から電子を供給することにより、ガスを励起させるのに

率が向上するとともに、放電が開始する放電開始電圧お よび放電を維持するための電圧を低減することができる から、発光効率が向上するとともに低消費電力化を図る ことができ、しかも、弾道電子面放出型の電子エミッタ は電子放出特性の真空度依存性が小さくて例えばプラズ マディスプレイパネルの表示セル内のような数十kPa の圧力中でも比較的低い駆動電圧で安定して電子を放出 することができるので、安定性を高めることができる。 【0011】請求項2の発明は、請求項1の発明におい 10 て、前記ガスは、紫外線を発生するガスからなるので、 例えば、気密容器の内壁面に紫外線により励起されて発 光する蛍光体層を被着しておくことにより所望の発光色 を得ることが可能になる。

【0012】請求項3の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、前記気密容器に設けられた対になる 放電用電極と、当該対になる放電用電極間に直流電圧を 印加して前記気密容器内へ電界を印加する電界印加手段 とを備えるので、例えば直流放電型のプラズマディスプ レイパネルへの応用が可能になる。

【0013】請求項4の発明は、請求項3の発明におい て、前記電界印加手段は、前記ガスが放電する放電開始 電圧よりも小さな直流電圧を前記対になる放電用電極間 に印加する機能を備えるので、放電開始電圧よりも小さ な電圧で動作させることによって発光効率がさらに向上 し、また、プラズマからのイオンなどの衝突によって前 記電子エミッタが受けるダメージを低減することができ 長寿命化を図ることができる。

【0014】請求項5の発明は、請求項3の発明におい て、前記電子エミッタは、前記放電用電極へ流れる電流 を制限するように前記対になる放電用電極間に配置され ているので、前記放電用電極へ過大な電流が流れるのを 前記電子エミッタによって防ぐことができ、長寿命化を 図ることができ、しかも、前記放電用電極へ流れる電流 を制限するための保護抵抗を別途に設ける必要がないか ら、保護抵抗を形成するためのプロセスを削減できる。 【0015】請求項6の発明は、請求項3の発明におい て、前記電子エミッタの前記表面電極と前記下部電極と の間へ前記駆動電圧を印加して前記電子エミッタを駆動 する駆動手段を備え、駆動手段は、放電開始以前から前 記電子エミッタを駆動させる機能を有するので、放電開 始以前から前記電子エミッタを駆動して前記ガス中へ電 子を供給することで従来のような補助セルを設けること なしに、電界印加手段によって直流電圧を印加したとき に放電が開始するまでに要する時間を短縮することが可 能になる。

【0016】請求項7の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、前記気密容器に設けられた対になる 放電用電極と、当該対になる放電用電極間に交流電圧を 印加して前記ガスを放電させる電界印加手段と、前記電 必要なエネルギを減少させることができ、ガスの励起効 50 子エミッタの前記表面電極と前記下部電極との間へ前記

駆動電圧を印加して前記電子エミッタを駆動する駆動手 段を備え、駆動手段は、放電開始以前から前記電子エミ ッタを駆動させる機能を有するので、例えば交流放電型 のプラズマディスプレイパネルの表示セルへの応用が可 能になり、また、電界印加手段によって交流電圧を印加 したときに放電が開始するまでに要する時間を短縮する ことが可能になるとともに、放電開始電圧を低減させる ことが可能になる。

【0017】請求項8の発明は、請求項1ないし請求項 7の発明において、前記電子エミッタは、前記気密容器 10 内に配設されているので、前記電子エミッタから前記ガ ス中へ電子を効率的に供給することができる。

【0018】請求項9の発明は、請求項8の発明におい て、前記電子エミッタは、前記気密容器の内壁面に配設 されているので、前記電子エミッタを前記気密容器の内 壁面に形成することができ、製造が容易になる。

【0019】請求項10の発明は、請求項1ないし請求 項9の発明において、前記電子エミッタの前記表面電極 と前記下部電極との間へ前記駆動電圧を印加して前記電 子エミッタを駆動する駆動手段を備え、駆動手段は、前 20 記電子エミッタからピークエネルギが3eV以下若しく は10eV以上の電子が放出されるように前記電子エミ ッタを駆動するので、前記ガス中への電子の注入効率を 向上させることができる。

【0020】請求項11の発明は、請求項10の発明に おいて、前記駆動手段は、18V以上の駆動電圧で前記 電子エミッタを駆動するので、前記電子エミッタから放 出される電子のエネルギ分布におけるピークエネルギが 10e V以上になるから、前記ガス中への電子の注入効 率を向上させることができる。

[0021]

【発明の実施の形態】 (実施形態1) 本実施形態では、 図2に示す基本構成を有する電子エミッタ付発光装置を 表示セルとして応用したDC型の反射型PDPを例示す

【0022】まず、図2に示す電子エミッタ付発光装置 について説明する。

【0023】図2に示す電子エミッタ付発光装置は、表 示電極の一部を構成し放電用電極を兼ねる透明電極 2 1 が設けられた前面ガラス基板20と、放電用電極14が 設けられた背面ガラス基板11とを対向配置し、前面ガ ラス基板20と背面ガラス基板11との間にスペーサ1 2を介在させ、前面ガラス基板20と背面ガラス基板1 1とスペーサ12とを有する気密容器内の空間CにXe ガスを封入してある。また、気密容器の一部を構成する 背面ガラス基板11における前面ガラス基板20との対 向面上には上記放電用電極14が配設してあり、放電用 電極14上に電子エミッタ10を配置してある。また、 気密容器の内壁面に蛍光体層13が被着されている。蛍 光体層13は、背面ガラス基板11における前面ガラス 50 り、下部電極8から注入された電子が強電界ドリフト層

基板20との対向面であって放電用電極14および電子 エミッタ10に重ならない部位とスペーサ12とに跨っ て被着されている。すなわち、気密容器の内壁面におい て前面ガラス基板20の部分および電子エミッタ10に 対応した部分以外の略全体にわたって蛍光体層13を被 着してある。なお、気密容器内の空間Cに封入するXe ガスのガス圧は、数十kPa程度に設定してある。ま た、図2に示したエミッタ付発光装置は、透明電極21 と放電用電極14とが対をなしたものであり、透明電極 21と放電用電極14との間に直流電圧を印加して気密 容器内へ電界を印加する電界印加手段たる直流電源(図

示せず)を備えている。

【0024】電子エミッタ10は、図3に示すような基 本構成を有するものであって、背面ガラス基板11の一 表面側に導電性層よりなる下部電極8が形成され、下部 電極8上に酸化した多孔質多結晶シリコン層よりなる強 電界ドリフト層6が形成され、強電界ドリフト層6上に 導電性薄膜よりなる表面電極7が形成されている。 ここ に、強電界ドリフト層6は、下部電極8上にノンドープ の多結晶シリコン層を堆積させた後に、該多結晶シリコ ン層を陽極酸化処理にて多孔質化して多孔質多結晶シリ コン層を形成し、さらに多孔質多結晶シリコン層を室温 の電解質溶液(例えば、1 MのH2SO4の水溶液)中で 電気化学的に酸化することによって形成されている。ま た、表面電極7は、強電界ドリフト層6上に形成された 膜厚が2nmのクロム薄膜と、クロム薄膜上に積層され た膜厚が8 nmの金薄膜とからなる導電性薄膜により構 成してある。

【0025】なお、表面電極7の材料はAuやCrに限 30 定されるものではなく、表面電極7の材料として、P t, W, Ru, Ir, Al, Sc, Ti, V, Mn, F e, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Y, Zr, Nb, Mo、Tc、Rh、Pd、Ag、Cd、Ln、Sn、T a, Re, Os, Tl, Pb, La, Ce, Pr, N d, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, E r、Tm、Yb、Luなど、およびそれらの酸化物や組 み合わせなどであってもよい。また、表面電極7の膜厚 は例えば10 nm~15 nmの範囲内で設定し、より小 さくすることが望ましいが、表面電極7の成膜時にいわ ゆる島状成長してしまうような膜厚では表面電極7の断 線などの問題を引き起こす恐れがあるので、表面電極7 の膜厚は表面電極7の材料および成膜方法に応じて適宜 設定すればよい。

【0026】図3に示した電子エミッタ10では、表面 電極7を真空中に配置するとともに図4に示すように表 面電極7に対向してコレクタ電極21を配置し、表面電 極7を下部電極8に対して正極として直流の駆動電圧V psを印加するとともに、コレクタ電極21を表面電極7 に対して正極として直流電圧Vcを印加することによ

6をドリフトし表面電極7を通して放出される(なお、 図4中の一点鎖線は表面電極7を通して放出された電子 e-の流れを示す)。ここにおいて、表面電極7と下部 電極8との間に流れる電流をダイオード電流 I psと称 し、コレクタ電極12と表面電極7との間に流れる電流 を放出電子電流 I eと称し、ダイオード電流 I psに対す る放出電子電流 I eが大きい(I e/ I psが大きい)ほど 電子放出効率が高くなる。なお、この電子エミッタ10 では、表面電極7と下部電極8との間に印加する駆動電 圧Vpsを10~20V程度の低電圧としても電子を放出 10 いる。ここに、アドレス電極14は、バリアリブ12に させることができる。

【0027】この電子エミッタ10では、電子放出特性 の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現 象が発生せず安定して電子を高い電子放出効率で放出す ることができる。ここにおいて、強電界ドリフト層6 は、図5に示すように、少なくとも、背面側ガラス基板 11の主表面側に列設された柱状の多結晶シリコンのグ レイン(半導体結晶)51と、グレイン51の表面に形 成された薄いシリコン酸化膜52と、グレイン51間に 介在するナノメータオーダのシリコン微結晶63と、シ リコン微結晶63の表面に形成され当該シリコン微結晶 63の結晶粒径よりも小さな膜厚の絶縁膜であるシリコ ン酸化膜64とから構成されると考えられる。すなわ ち、強電界ドリフト層6は、各グレインの表面が多孔質 化し各グレインの中心部分では結晶状態が維持されてい ると考えられる。したがって、強電界ドリフト層6に印 加された電界はほとんどシリコン酸化膜64にかかるか ら、注入された電子はシリコン酸化膜64にかかってい る強電界により加速され多結晶シリコンのグレイン51 間を表面に向かって図5中の矢印Aの向きへ(図5中の 30 上方向へ向かって)ドリフトするので、電子放出効率を 向上させることができる。ここに、強電界ドリフト層6 の表面に到達した電子はホットエレクトロンであると考 えられ、表面電極7を容易にトンネルし真空中に放出さ れる。なお、この電子エミッタ10の電子放出原理は、 弾道電子放出現象と呼ばれており、電子エミッタ10は 弾道電子面放出型の電子エミッタである。

【0028】なお、本実施形態では、強電界ドリフト層 6を酸化した多孔質多結晶シリコン層により構成してい るが、強電界ドリフト層6を窒化した多孔質多結晶シリ 40 コン層、あるいは、その他の酸化若しくは窒化した多孔 質半導体層(多孔質単結晶半導体層、多孔質アモルファ ス半導体層など)により構成してもよい。また、多結晶 シリコンはノンドープに限らず、ドーピングしたもので

【0029】以下、上述の電子エミッタ付発光装置を表 示セル (放電セル) として応用したPDPについて図1 を参照しながら説明する。

【0030】図1に示した構成のPDPは、矩形板状の 前面ガラス基板20と矩形板状の背面ガラス基板11と 50 タ10から電子を供給することにより、紫外線生成に寄

を対向配置し、前面ガラス基板20と背面ガラス基板1 1との間に上記スペーサとしてのバリアリブ12を介在 させてある。ここにおいて、背面ガラス基板11におけ る前面ガラス基板20との対向面には複数のバリアリブ 12が列設されている。すなわち、複数のバリアリブ1 2が全体としてストライプ状に配設されている。背面ガ ラス基板11における前面ガラス基板20との対向面で あって隣り合うバリアリブ12の間の部位の略中央には 上記放電用電極としてのアドレス電極14が配設されて 長手方向が一致するように配設されている。要するに、 背面ガラス基板11にはバリアリブ12とアドレス電極 14とが交互に配設されている。

【0031】また、アドレス電極14の両側には蛍光体 層13が形成されている。蛍光体層13は背面ガラス基 板11とバリアリブ12とに跨って形成されている。ま た、アドレス電極14における前面ガラス基板20側に は電子エミッタ10が配設されている。ここに、電子エ ミッタ10はアドレス電極14が上述の下部電極8を兼 ねている。すなわち、電子エミッタ10は、アドレス電 極14上に上述の強電界ドリフト層6が形成されてい る。また、前面ガラス基板20における背面ガラス基板 11との対向面には、アドレス電極14に交差する方向 に複数の透明電極21が列設されている。また、透明電 極21における背面ガラス基板11側には透明電極21 の電気抵抗による電圧低下を防ぐためのバス電極22が 形成されており、透明電極21とバス電極22とで表示 電極を構成している。要するに、アドレス電極14、電 子エミッタ10、バリアリブ12、蛍光体層13は長手 方向が一致している。なお、バリアリブ12は、放電時 に隣接する表示セルへの影響を防止する機能と、隣接す る表示セル間の光の混合を防ぐ機能とを備えている。

【0032】図1に示したPDPは、前面ガラス基板2 0、背面ガラス基板11、隣り合う一対のバリアリブ1 2などにより前面ガラス基板20と背面ガラス基板11 との間に気密空間が形成された表示セルを構成してお り、表示セル内に電子エミッタ10が配置されている。 【0033】ところで、表示セルにおいて、背面ガラス 基板11における前面ガラス基板20との対向面と隣り 合うバリアリブ12とに跨って蛍光体層13が被着され ており、表示セル内に封入されたガスが励起することに より発生する紫外線によって可視光を発光する。なお、 蛍光体層13は、電子エミッタ10上には設けていな

【0034】上述のPDPでは、従来から周知のPDP と同様に直流電圧を印加する透明電極21とアドレス電 極14との組を選択して適宜電圧を印加すれば、透明電 極21とアドレス電極14との交点に相当する部位でガ スが放電するが、本実施形態では、ガス中へ電子エミッ

与しないイオンの生成によるエネルギの損失を増加させ ることなく電子密度を向上させることができ、Xeガス の励起効率を向上させることができ、また、Xeガスを 励起させるのに必要なエネルギを減少させることがで き、放電が開始する放電開始電圧および放電を維持する ための電圧を低減することができるから、発光効率が向 上するとともに低消費電力化を図ることができる。しか も、電子エミッタ10が上述のように、表面電極7と下 部電極8との間に酸化若しくは窒化した多孔質半導体層 よりなる強電界ドリフト層6を有し表面電極7と下部電 10 極8との間に直流電圧を印加することにより下部電極8 から強電界ドリフト層6へ注入された電子が表面電極7 を通して放出される弾道電子面放出型の電子エミッタか らなるので、電子放出特性の真空度依存性が小さいか ら、プラズマディスプレイパネルの表示セル内のような 数十kPaの圧力中でも比較的低い低駆動電圧で安定し て電子を放出することができ、安定性を高めることがで きる。ここにおいて、表示セル内に電子エミッタ10を 設けていない場合には、表示セル内のガス圧はパッシェ ンの法則に従い表示セルのサイズにより決まるが、電子 20

【0035】なお、気密容器となる表示セルの内壁面には、紫外線により励起されて発光する蛍光体層13が被着されているので、蛍光体層13の材料として適宜材料を用いることで、所望の発光色を得ることができる。

エミッタ10を設けたことによって、より広い圧力範囲

で駆動させることが可能になる。

【0036】また、本実施形態では、上記電界印加手段が、Xeガスが放電する放電開始電圧よりも小さな直流電圧を対になる透明電極21とアドレス電極14との間に印加する機能を備えるので、放電開始電圧よりも小さ 30な電圧で動作させることによって発光効率がさらに向上し、また、プラズマからのイオンなどの衝突によって電子エミッタ10が受けるダメージを低減することができ長寿命化を図ることができる。

【0037】なお、本実施形態では、表示セル内の空間に電子エミッタ10を設置して、電子エミッタ10からの放出電子をガス中へ供給しているが、電子エミッタ10を表示セルの外部に設置して、放出電子を表示セル内に導入するようにしてもよい。また、表示セル内に封入するガスはXeガスだけに限定されるものではなく、例40えばNeガスとXeガスとの混合ガスでもよいし、放電開始電圧や放電を維持するための電圧が低く且つ紫外線を大量に発生し、可視光の発生が少なく、放電に起因した蛍光体層13へのダメージが少ないガスであればよく、Neガスの代わりにHeガスを封入してもよいし、Heガスを加えてもよい。

【0038】以下、本実施形態のPDPの製造方法について説明する。

【0039】前面ガラス基板20は、背面ガラス基板1 開始電圧よりも大きな電圧を表示電極間に 1と対向させる面上に、例えばITOよりなる透明電極 50 間放電によるエージングを行ってもよい。

10 21を形成した後、透明電極21上にCr/Cu/Cr

よりなるバス電極22を形成し、その後、周部に低融点ガラスよりなるシール層(図示せず)を5mm幅で形成し焼成する。なお、本実施形態では、透明電極21としてITO膜を用いているが、透明電極21の材料はITOに限定されるものではなく、例えばIZOを用いてもよい。

【0040】一方、背面ガラス基板20は、直径が1mm程度の排気およびガス封入用の貫通孔を4隅のうちの1箇所近傍に形成した後、Agよりなるアドレス電極14を例えば印刷法により形成し、その後、アドレス電極14上にノンドープの多結晶シリコン層を形成し、次に、該多結晶シリコン層をフッ化水素水溶液とエタノールとの混合液中での陽極酸化処理にて多孔質化して多孔質多結晶シリコン層を形成し、さらに多孔質多結晶シリコン層を室温の電解質溶液(例えば、1MのH2SO4の水溶液)中で電気化学的に酸化することにより強電界ドリフト層6を形成する。続いて、強電界ドリフト層6を形成する。続いて、強電界ドリフト層6を形成するではより、アドレス電極14と強電界ドリフト層6と表面電極7とからなる電子エミッタ10が得られる。

【0041】また、アドレス電極14の幅方向の両側に 例えば低融点ガラスよりなるバリアリブ12を印刷法に より形成する。ここに、印刷法によるバリアリブ12の 形成にあたっては、十数回の重ね合わせ印刷を行う。な お、バリアリブ12を形成する方法としては、印刷法の 他にサンドブラスト法、リフトオフ法、埋め込み法など の方法を採用してもよい。

0 【0042】背面ガラス基板11は、アドレス電極14 および電子エミッタ10およびバリアリブ12を形成し た後、R. G. Bの蛍光体層13を印刷法などにより形成し、その後、周部にシール層を形成して焼成する。 【0043】以上のようにして構成された前面ガラス基板20と背面ガラス基板11とを、透明電極21とアドレス電極14とが直交するように位置合わせして互いのシール層同士を重ね合わせる。その後、Xeガスを導入するためのガラス管を背面ガラス基板11の上記貫通孔に対応した位置に配置し、焼成することでガラス管を背の面ガラス基板11に取り付ける。

【0044】その後、全体を高温焼成炉内に設置し、400℃程度の温度環境下で前面ガラス基板20と背面ガラス基板11との間の空間にある空気などを排気してから、上記空間へXeガスを封入する。Xeガスのガス圧は数十kPa程度に設定されているが、外気圧により前面ガラス基板20がバリアリブ12の先端面に密着するようになっている。その後、上記ガラス管を封じ切ることによりPDPのパネル本体が完成する。その後、放電開始電圧よりも大きな電圧を表示電極間に印加して長時間放電にトスエージングを行ってもよい

【0045】なお、本実施形態では背面ガラス基板11 にバリアリブ12を設けてあるが、前面ガラス基板20 における背面ガラス基板11との対向面にリブを設けて もよい。また、バリアリブ12を形成した後に電子エミ ッタ10を形成してもよい。

【0046】ところで、本実施形態では、表示セルに印 加する電圧を放電開始電圧よりも小さくすることで、表 示セル内での放電を起こすことなくXe ガスの励起を行 うことができ、更なる効率の向上を図ることができる。 【0047】いま、バリアリブ12の高さを100µm 10 に設定し、つまり、前面ガラス基板20と背面ガラス基 板11との間のギャップを100μmに設定し、表示セ ル内の空間に67kPaのXeガスのみが封入されたも のとして、透明電極21とアドレス電極14との間に直 流電圧を印加する場合について種々のシミュレーション を行った結果について図6ないし図10を参照しながら 説明する。ここに、陰極となるアドレス電極14は電子 放出の機能を持っているが、二次電子は放出しないもの とする。また、陽極となる透明電極21は電子のコレク タとして働き、電子エミッタ10から放射される電子の 20 放射束は任意に設定できるものとする。また、電子エミ ッタ10は間欠的に動作させ、3μ秒の動作期間と1μ 秒の停止期間とを交互に繰り返すものとする。

【0048】図6は電子エミッタ10から放出されるエ ミッタ電流の電流密度と、透明電極21に流れるコレク 夕電流とエミッタ電流との比である電流増幅率との関係 を種々の印加電圧についてシミュレーションした結果で あり、同図中のイは印加電圧を50Vとしたとき、口は 印加電圧を70Vとしたとき、ハは印加電圧を90Vと したとき、二は印加電圧を110Vとしたとき、ホは印 30 加電圧を130Vとしたとき、へは印加電圧を150V としたときをそれぞれ示す。 図6から、電流増幅率は、 印加電圧、エミッタ電流の電流密度それぞれの増大とと もに大きくなることが分かる。

【0049】また、エミッタ電流の電流密度と紫外線放 射エネルギとの関係を図6のイ~へと同じ印加電圧それ ぞれについてシミュレーションした結果を図7に示す。 ところで、XeガスとNeガスとを1:9の割合で混合 した混合ガスが封入された従来のPDPの紫外線エネル ギと同等の 0.6μ J/cm²を得るためには、図7か ら、印加電圧を150Vとしたときに0.45mA/c m²のエミッタ電流密度が必要となり、印加電圧を13 OVとしたときに略1mA/cm2のエミッタ電流密度 が必要となり、印加電圧を50Vとしたときに7.3m A/c m²のエミッタ電流密度が必要となることが分か る。図8に0.6μJ/cm²の紫外線エネルギを得る ために必要な印加電圧とエミッタ電流の電流密度との関 係を示す。

【0050】また、印加電圧と紫外線放射効率との関係

放射効率は印加電圧の増大とともに減少しているが、印 加電圧の増大に伴って紫外線放射効率が減少する原因 は、印加電圧の増大に伴い紫外線生成に寄与しないイオ ンの生成によるエネルギ損失が増えるためである。 【0051】図9から、例えば電子エミッタ10から電 流密度が1 m A / c m²程度になるように電子を放出さ せれば、紫外線放射効率が約20%になることが分か る。従来のPDPの紫外線放射効率は約2%程度である から、本実施形態のような電子エミッタ10を設けて電 子を供給することで、紫外線放射効率を大幅に向上でき る(紫外線放射効率を一桁程度大きくする)ことが分か る。

【0052】なお、上述のシミュレーションで用いた条 件は一例であり、条件の違いで印加電圧や電流の値が大 きく変わることもある。また、ガス圧も67kPaに限 定されるものではない。また、放電を起こすことなく紫 外線放射効率を向上させることができるので、パッシェ ンの法則に従う必要がなく、ガス圧を大気圧まで上げて も紫外線放射効率を向上させることができる。また、プ ラズマ中のイオンや中性粒子の衝突により電子エミッタ 10が受けるダメージを低減することもできる。

【0053】なお、本実施形態で説明したものでは、電 子エミッタ10の放出電子電流(エミッション電流)Ⅰ eの電流密度を7mA/cm²以上にすれば、イオン化 率も低減され、イオンボンバードなどによるダメージを さらに低減することができ、長寿命化および安定性の向 上の面から望ましい。

【0054】ところで、従来のDC型のPDPでは、放 電電流の増加に伴って放電電圧が上昇する図10中の異 常グロー放電領域bで動作させているので、印加電圧を 調節することで放電電流を制御することができる。しか しながら、異常グロー放電領域bで動作させると、スパ ッタリングによる透明電極21やアドレス電極14の損 傷が大きく、寿命が短くなってしまうという問題があっ た。一方、セル内のガス圧を高めればスパッタリングを 低減でき、発光効率が向上するが、放電は図6中の正常 グロー放電領域aとなり、正常グロー放電では放電電流 を増加させても放電電圧は一定ないし減少するので、放 電電流を制限しないと過大な放電電流が流れて表示セル 40 を破壊してしまうから、放電電流を制限する手段が必要 となる。そこで、従来のPDPにおいては、個々の表示 セル毎に保護抵抗を設けることが提案され実用化されて いる。しかしながら、保護抵抗を形成するためのプロセ スが必要となるとともに、パネル構造が複雑になるとい う問題があった。

【0055】これに対し、本実施形態のPDPでは、表 示電極とアドレス電極14との間に電子エミッタ10が 配置され、電子エミッタ10の下部電極8がアドレス電 極14により構成されているので、電子エミッタ10が のシミュレーション結果を図9に示す。図9から紫外線 50 放電電流を制限する保護抵抗としての機能を備えること

になり、従来のように別途に保護抵抗を形成する必要が なく、保護抵抗を形成するためのプロセスを追加するこ となく長寿命化を図ることができる。

【0056】また、一般的にPDPにおいて256階調 の表示を行うためには、表示電極とアドレス電極14と の間へ直流電圧を印加したときに1 4 秒以内に放電を開 始(始動)させる必要があり、従来のPDPにおいては 表示セルの間に設けた補助放電セルで種火となる放電を 表示セルの放電とは無関係に常時発生させているので、 消費電力が大きくなってしまうとう問題があり、また、 補助セルを設けることにより製造プロセスが複雑になる とともに、開口率およびコントラストが低下してしまう という問題があった。

【0057】これに対して、本実施形態のPDPでは、 表示セル内に封入されたXeガスを放電させる以前から 電子エミッタ10を駆動して電子を常時放出させておけ ば、上記直流電圧を印加したときに1ル秒以内に放電を 開始させることが可能になるので、従来のような補助セ ルを設ける必要がなく、開口率およびコントラストが低 下することもない。また、上述の電子エミッタ10は、 補助セルで種火となる放電を発生させるための電圧に比 べて低電圧で電子を放出することができるから、低消費 電力化を図ることができる。

【0058】ところで、本実施形態のように気密容器と しての表示セル内に封入されたXeガス中へ電子エミッ タ10から放出された電子を注入する際、その注入効率 は電子エネルギに依存する。例えば67kPaのXeガ ス中への注入効率と電子エネルギとの関係をモンテカル 口法でシミュレーションして得られた注入効率の電子エ ネルギ依存性から、電子エネルギが6eV程度のときに 30 注入効率が極小となることがわかった。このような注入 効率の電子エネルギ依存性は、電子とXe原子との弾性 衝突断面積のエネルギ依存性によるものと考えられる。 上述のシミュレーションの結果から、注入効率を向上さ せるためには、電子エネルギが3eV以下若しくは10 eV以上になるようにすることが望ましい。

【0059】これに対し、上述の電子エミッタ10から 放射される電子のエネルギN(E)のエネルギ分布は図 11に示すようになる。ここに、図11中のイは上記駆 動電圧Vpsを12Vとした場合、口は駆動電圧Vpsを1 4 Vとした場合、ハは駆動電圧 Vpsを16 Vとした場 合、をそれぞれ示す。図11から、電子のエネルギN (E) のエネルギ分布は比較的ブロードであって、駆動 電圧Vpsの増加とともにピークエネルギが高エネルギ側 ヘシフトすることが分かる。上述の電子エミッタ10に おける駆動電圧Vpsとピークエネルギとの関係は図12 に示すようになり、駆動電圧Vpsを5Vよりも大きくす ることで電子が放出され、駆動電圧Vpsが5V~30V の範囲では駆動電圧psの増加に伴ってピークエネルギが 大きくなっていることが分かる。また、上述の電子エミ 50 加手段たる交流電源(図示せず)から交流電圧が印加さ

ッタ10では、駆動電圧Vpsの増加に伴って放出電子電 流 (エミッション電流) Ieが増大することが知られて

【0060】したがって、上述の電子エミッタ10から 放射される電子のエネルギのピークエネルギが3eV以 下となるような駆動電圧Vpsでは十分なエミッション電 流Ieが得られない。一方、電子エネルギが10eV以 上となるような駆動電圧Vpsを印加すれば、十分なエミ ッション電流Ieが得られ、Xeガス中への注入効率も 10 向上するので、電子エミッタ10については電子エネル ギが10eV以上となるような駆動電圧Vpsで駆動する ことが望ましい。

【0061】なお、図12から分かるように、電子エミ ッタ10の駆動電圧Vpsが16Vのときのピークエネル ギが8.4eVとなっているが、表面電極7に用いるA uの仕事関数が約5eVであることを考えると、ピーク エネルギの値は電位差の約76%の値になっていること が分かる。このことから、電子エネルギ分布のピークエ ネルギを例えば15eVとするには、駆動電圧Vpsを2 20 5Vとする必要があることになり、電子エネルギ分布の ピークエネルギを10eVとするには、駆動電圧Vpsを 約18 Vとすればよいことが分かる。 言い換えれば、上 述の電子エミッタ10は、駆動電圧Vpsを18V以上と することにより、放射される電子のエネルギ分布におけ るピークエネルギが10eV以上となる。

【0062】なお、図2に示す電子エミッタ付発光装置 では、電子エミッタ10から同図中に矢印Aで示す向き に電子が放出され、同図中に矢印Bで示すように前面ガ ラス基板20を通して外部へ光が取り出される。

【0063】(実施形態2)本実施形態では、AC型の PDPの表示セル (放電セル) として応用可能な図13 に示す電子エミッタ付発光装置を例示する。なお、実施 形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を 省略する。

【0064】ところで、従来のAC型のPDPの放電セ ルは、図14に示すような基本構成を有し、周知のよう に、前面ガラス基板20における背面ガラス基板11と の対向面に、対をなす2つの透明電極21,21が形成 され、両透明電極21,21を覆うように誘電体層23 が形成され、さらに誘電体層23を覆うようにMgO膜 24が形成されている。一方、背面ガラス基板11にお ける前面ガラス基板20との対向面上にはアドレス電極 14が形成され、アドレス電極14を覆うように蛍光体 層13が形成されている。ここに、蛍光体層13は表示 セル内の内壁面において底面と内側面とに跨って形成さ れており、図14に示す基本構成の表示セルを用いたA C型のPDPでは、誘電体層23に蓄積された壁電荷を 利用して放電開始電圧(トリガ電圧)を低減させてい る。ここに、対をなす透明電極21,21間には電界印

れる。なお、図14に示す基本構成では、同図中に矢印 Bで示すように前面ガラス基板20を通して外部へ光が 取り出される。

【0065】これに対して、本実施形態では、図13に示すように、実施形態1と同様にアドレス電極14上に電子エミッタ10が形成されているので、放電させる以前から、あるいは常時、電子エミッタ10を駆動手段たる直流電源(図示せず)によって駆動することによって、放電開始電圧を図14の構成に比べてさらに低減することが可能になる。なお、本実施形態では、電子エミリッタ10が蛍光体層13に被覆されていないので、表示セル内で放電を発生させる場合にはプラズマに曝されるが、電子エミッタ10を蛍光体層13により被覆してもよい。ただし、蛍光体層13で電子エミッタ10を被覆することで、電子エミッタ10からの電子放出効率は低下することもありうる。

【0066】(実施形態3)本実施形態では、DC型の

PDPの表示セルとして応用可能な図15に示す電子エ

ミッタ付発光装置を例示する。なお、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。 【0067】ところで、従来のDC型のPDPの一種である反射型PDPの表示セルは、図16に示すような基本構成を有し、周知のように、前面ガラス基板20における背面ガラス基板11との対向面に透明電極21が形成されている。一方、背面ガラス基板11における前面ガラス基板20との対向面上にはアドレス電極14が形成され、アドレス電極14の周辺からバリアリブ12にかけて蛍光体層13が形成されている。ここに、蛍光体

層13は表示セル内の内壁面である底面と内側面とに跨

って形成されている。ここに、対をなす透明電極21と

アドレス電極14との間には電界印加手段たる直流電源

(図示せず)から直流電圧が印加される。なお、図16

に示す基本構成では、同図中に矢印Bで示すように前面

ガラス基板20を通して外部へ光が取り出される。

【0068】これに対して、本実施形態では、図15に示すように、前面ガラス基板20における背面ガラス基板11との対向面に形成された透明電極21に重なる形で電子エミッタ10が形成されている。ここに、電子エミッタ10は、透明電極21が実施形態1で説明した下部電極8を兼ねており、表面電極7が背面ガラス基板11に対向している。要するに、図15に示す基本構成では、電子エミッタ10から同図中に矢印Aで示す向きに電子が放出され、同図中に矢印Bで示すように前面ガラス基板20を通して外部へ光が取り出される。

様に、ガス中へ電子エミッタ10から電子を供給するこ とにより、紫外線生成に寄与しないイオンの生成による エネルギの損失を増加させることなく電子密度を向上さ せることができ、Xeガスの励起効率を向上させること ができ、また、Xeガスを励起させるのに必要なエネル ギを減少させることができ、放電が開始する放電開始電 圧および放電を維持するための電圧を低減することがで きるから、発光効率が向上するとともに低消費電力化を 図ることができる。しかも、電子エミッタ10が上述の ように、表面電極7と下部電極8との間に酸化若しくは 窒化した多孔質半導体層よりなる強電界ドリフト層6を 有し表面電極7と下部電極8との間に直流電圧を印加す ることにより下部電極8から強電界ドリフト層6へ注入 された電子が表面電極7を通して放出される弾道電子面 放出型の電子エミッタからなるので、電子放出特性の真 空度依存性が小さいから、プラズマディスプレイパネル の表示セル内のような数十kPaの圧力中でも比較的低 い低駆動電圧で安定して電子を放出することができ、安 定性を高めることができる。

20 【0070】また、本実施形態では、前面ガラス基板2 0側に電子エミッタ10を設けているので、背面ガラス 基板11側の作製プロセスを従来から変更する必要がな く、背面ガラス基板11側に電子エミッタ10を設ける 場合に比べて簡単に製造することが可能になる。

【0071】(実施形態4)本実施形態の電子エミッタ付発光装置の基本構成は図15に示した実施形態3と略同じであって、図17に示すように、電子エミッタ10をバリアリブ12に設けている点が相違する。本実施形態では、背面ガラス基板11側に実施形態1と同様の方法でバリアリブ12を形成した後に、電子エミッタ10をバリアリブ12へ付加する工程を加えればよい。なお、実施形態3と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0072】しかして、本実施形態においても、電子エ ミッタ10が表示セル内に配設されているので、放電さ せる以前から、あるいは常時、電子エミッタ10を図示 しない駆動手段によって駆動することによって、図16 の構成に比べて放電開始電圧を低減することが可能にな る。要するに、本実施形態においても、実施形態1と同 様に、ガス中へ電子エミッタ10から電子を供給するこ とにより、紫外線生成に寄与しないイオンの生成による エネルギの損失を増加させることなく電子密度を向上さ せることができ、Xeガスの励起効率を向上させること ができ、また、Xeガスを励起させるのに必要なエネル ギを減少させることができ、放電が開始する放電開始電 圧および放電を維持するための電圧を低減することがで きるから、発光効率が向上するとともに低消費電力化を 図ることができる。しかも、電子エミッタ10が上述の ように、表面電極7と下部電極8との間に酸化若しくは

有し表面電極7と下部電極8との間に直流電圧を印加することにより下部電極8から強電界ドリフト層6へ注入された電子が表面電極7を通して放出される弾道電子面放出型の電子エミッタからなるので、電子放出特性の真空度依存性が小さいから、プラズマディスプレイパネルの表示セル内のような数十kPaの圧力中でも比較的低い低駆動電圧で安定して電子を放出することができ、安定性を高めることができる。

【0073】(実施形態5)本実施形態では、DC型のPDPの表示セルとして応用可能な図18に示す電子エ 10ミッタ付発光装置を例示する。なお、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0074】ところで、従来のDC型のPDPの一種である透過型PDPの表示セルは、図19に示すような基本構成を有し、周知のように、前面ガラス基板20における背面ガラス基板11との対向面に透明電極21が形成され、透明電極21の周囲に蛍光体層13が形成されている。一方、背面ガラス基板11における前面ガラス基板20との対向面上にはアドレス電極14が形成されている。ここに、対をなす透明電極21とアドレス電極2014との間には電界印加手段たる直流電源(図示せず)から直流電圧が印加される。

【0075】これに対して、本実施形態では、図18に示すように、背面ガラス基板11上に形成されたアドレス電極14上に電子エミッタ10が形成されている。ここに、電子エミッタ10は、アドレス電極14が実施形態1で説明した下部電極8を兼ねており、表面電極7が前面ガラス基板20に対向している。要するに、図18に示す基本構成では、電子エミッタ10から同図中に矢印Aで示す向きに電子が放出される。

【0076】しかして、本実施形態においても、電子エ ミッタ10が表示セル内に配設されているので、放電さ せる以前から、あるいは常時、電子エミッタ10を図示 しない駆動手段によって駆動することによって、図19 の構成に比べて放電開始電圧を低減することが可能にな る。要するに、本実施形態においても、実施形態1と同 様に、ガス中へ電子エミッタ10から電子を供給するこ とにより、紫外線生成に寄与しないイオンの生成による エネルギの損失を増加させることなく電子密度を向上さ せることができ、Xeガスの励起効率を向上させること 40 ができ、また、Xeガスを励起させるのに必要なエネル ギを減少させることができ、放電が開始する放電開始電 圧および放電を維持するための電圧を低減することがで きるから、発光効率が向上するとともに低消費電力化を 図ることができる。しかも、電子エミッタ10が上述の ように、表面電極7と下部電極8との間に酸化若しくは 窒化した多孔質半導体層よりなる強電界ドリフト層6を 有し表面電極7と下部電極8との間に直流電圧を印加す ることにより下部電極8から強電界ドリフト層6へ注入

放出型の電子エミッタからなるので、電子放出特性の真 空度依存性が小さいから、プラズマディスプレイパネル の表示セル内のような数十kPaの圧力中でも比較的低 い低駆動電圧で安定して電子を放出することができ、安 定性を高めることができる。

【0077】また、本実施形態では、背面ガラス基板1 1側に電子エミッタ10を設けているので、蛍光体層1 3の被着面積を減少させることなく電子エミッタ10の 電子放出面積を増大させることができ、比較的容易にエ ミッタ電流を増加することが可能になる。

【0078】(実施形態6)本実施形態の電子エミッタ付発光装置の基本構成は図18に示した実施形態5と略同じであって、図20に示すように、電子エミッタ10をバリアリブ12に設けている点が相違する。本実施形態では、背面ガラス基板11側に実施形態1と同様の方法でバリアリブ12を形成した後に、電子エミッタ10をバリアリブ12へ付加する工程を加えればよい。なお、実施形態5と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0079】しかして、本実施形態においても、電子エ ミッタ10が表示セル内に配置されているので、放電さ せる以前から、あるいは常時、電子エミッタ10を図示 しない駆動手段によって駆動することによって、図19 の構成に比べて放電開始電圧を低減することが可能にな る。要するに、本実施形態においても、実施形態1と同 様に、ガス中へ電子エミッタ10から電子を供給するこ とにより、紫外線生成に寄与しないイオンの生成による エネルギの損失を増加させることなく電子密度を向上さ せることができ、Xeガスの励起効率を向上させること 30 ができ、また、Xeガスを励起させるのに必要なエネル ギを減少させることができ、放電が開始する放電開始電 圧および放電を維持するための電圧を低減することがで きるから、発光効率が向上するとともに低消費電力化を 図ることができる。しかも、電子エミッタ10が上述の ように、表面電極7と下部電極8との間に酸化若しくは 窒化した多孔質半導体層よりなる強電界ドリフト層6を 有し表面電極7と下部電極8との間に直流電圧を印加す ることにより下部電極8から強電界ドリフト層6へ注入 された電子が表面電極7を通して放出される弾道電子面 放出型の電子エミッタからなるので、電子放出特性の真 空度依存性が小さいから、プラズマディスプレイパネル の表示セル内のような数十kPaの圧力中でも比較的低 い低駆動電圧で安定して電子を放出することができ、安 定性を高めることができる。

図ることができる。しかも、電子エミッタ10が上述の ように、表面電極7と下部電極8との間に酸化若しくは 窒化した多孔質半導体層よりなる強電界ドリフト層6を 有し表面電極7と下部電極8との間に直流電圧を印加す ることにより下部電極8から強電界ドリフト層6へ注入 された電子が表面電極7を通して放出される弾道電子面 50 菌ランプなどへの新たな用途を創出することが期待でき

る。

[0081]

【発明の効果】請求項1の発明は、気密容器内に封入さ れたガスの励起に伴う発光を利用する発光装置へ前記ガ スを励起させるように前記ガス中へ電子を供給する電子 エミッタを付加したものであって、前記電子エミッタ が、表面電極と下部電極との間に酸化若しくは窒化した 多孔質半導体層よりなる強電界ドリフト層を有し表面電 極と下部電極との間に直流の駆動電圧を印加することに より下部電極から強電界ドリフト層へ注入された電子が 10 に放電が開始するまでに要する時間を短縮することが可 表面電極を通して放出される弾道電子面放出型の電子エ ミッタからなるものであり、ガス中へ電子エミッタから 電子を供給することにより、ガスを励起させるのに必要 なエネルギを減少させることができ、ガスの励起効率が 向上するとともに、放電が開始する放電開始電圧および 放電を維持するための電圧を低減することができるか ら、発光効率が向上するとともに低消費電力化を図るこ とができ、しかも、弾道電子面放出型の電子エミッタは 電子放出特性の真空度依存性が小さくて例えばプラズマ ディスプレイパネルの表示セル内のような数十kPaの 20 のプラズマディスプレイパネルの表示セルへの応用が可 圧力中でも比較的低い駆動電圧で安定して電子を放出す ることができるので、安定性を高めることができるとい う効果がある。

【0082】請求項2の発明は、請求項1の発明におい て、前記ガスは、紫外線を発生するガスからなるので、 例えば、気密容器の内壁面に紫外線により励起されて発 光する蛍光体層を被着しておくことにより所望の発光色 を得ることが可能になるという効果がある。

【0083】請求項3の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、前記気密容器に設けられた対になる 30 放電用電極と、当該対になる放電用電極間に直流電圧を 印加して前記気密容器内へ電界を印加する電界印加手段 とを備えるので、例えば直流放電型のプラズマディスプ レイパネルへの応用が可能になるという効果がある。

【0084】請求項4の発明は、請求項3の発明におい て、前記電界印加手段は、前記ガスが放電する放電開始 電圧よりも小さな直流電圧を前記対になる放電用電極間 に印加する機能を備えるので、放電開始電圧よりも小さ な電圧で動作させることによって発光効率がさらに向上 し、また、プラズマからのイオンなどの衝突によって前 40 は10eV以上の電子が放出されるように前記電子エミ 記電子エミッタが受けるダメージを低減することができ 長寿命化を図ることができるという効果がある。

【0085】請求項5の発明は、請求項3の発明におい て、前記電子エミッタは、前記放電用電極へ流れる電流 を制限するように前記対になる放電用電極間に配置され ているので、前記放電用電極へ過大な電流が流れるのを 前記電子エミッタによって防ぐことができ、長寿命化を 図ることができ、しかも、前記放電用電極へ流れる電流 を制限するための保護抵抗を別途に設ける必要がないか ら、保護抵抗を形成するためのプロセスを削減できると 50

いう効果がある。

【0086】請求項6の発明は、請求項3の発明におい て、前記電子エミッタの前記表面電極と前記下部電極と の間へ前記駆動電圧を印加して前記電子エミッタを駆動 する駆動手段を備え、駆動手段は、放電開始以前から前 記電子エミッタを駆動させる機能を有するので、放電開 始以前から前記電子エミッタを駆動して前記ガス中へ電 子を供給することで従来のような補助セルを設けること なしに、電界印加手段によって直流電圧を印加したとき 能になるという効果がある。

20

【0087】請求項7の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、前記気密容器に設けられた対になる 放電用電極と、当該対になる放電用電極間に交流電圧を 印加して前記ガスを放電させる電界印加手段と、前記電 子エミッタの前記表面電極と前記下部電極との間へ前記 駆動電圧を印加して前記電子エミッタを駆動する駆動手 段を備え、駆動手段は、放電開始以前から前記電子エミ ッタを駆動させる機能を有するので、例えば交流放電型 能になり、また、電界印加手段によって交流電圧を印加 したときに放電が開始するまでに要する時間を短縮する ことが可能になるとともに、放電開始電圧を低減させる ことが可能になるという効果がある。

【0088】請求項8の発明は、請求項1ないし請求項 7の発明において、前記電子エミッタは、前記気密容器 内に配設されているので、前記電子エミッタから前記ガ ス中へ電子を効率的に供給することができるという効果 がある。

【0089】請求項9の発明は、請求項8の発明におい て、前記電子エミッタは、前記気密容器の内壁面に配設 されているので、前記電子エミッタを前記気密容器の内 壁面に形成することができ、製造が容易になるという効

【0090】請求項10の発明は、請求項1ないし請求 項9の発明において、前記電子エミッタの前記表面電極 と前記下部電極との間へ前記駆動電圧を印加して前記電 子エミッタを駆動する駆動手段を備え、駆動手段は、前 記電子エミッタからピークエネルギが3eV以下若しく ッタを駆動するので、前記ガス中への電子の注入効率を 向上させることができるという効果がある。

【0091】請求項11の発明は、請求項10の発明に おいて、前記駆動手段は、18 V以上の駆動電圧で前記 電子エミッタを駆動するので、前記電子エミッタから放 出される電子のエネルギ分布におけるピークエネルギが 10 e V以上になるから、前記ガス中への電子の注入効 率を向上させることができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態を示し、エミッタ付発光装置を応用し

たプラズマディスプレイパネルの概略構成図である。

【図2】同上におけるエミッタ付発光装置の基本構成図

【図3】同上における電子エミッタの基本構成図であ る。

【図4】同上における電子エミッタの動作説明図であ る。

【図5】同上における電子エミッタの動作説明図であ

【図6】同上のシミュレーション結果による特性説明図 10 である。

【図7】同上のシミュレーション結果による特性説明図 である。

【図8】同上のシミュレーション結果による特性説明図 である。

【図9】同上のシミュレーション結果による特性説明図 である。

【図10】同上の動作説明図である。

【図11】同上における電子エミッタの特性説明図であ る。

【図12】同上における電子エミッタの特性説明図であ る。

【図13】実施形態2を示す概略構成図である。

【図14】同上の参考例の概略構成図である。

【図15】実施形態3を示す概略構成図である。

【図16】同上の参考例の概略構成図である。

【図17】実施形態4を示す概略構成図である。

【図18】実施形態5を示す概略構成図である。

【図19】同上の参考例の概略構成図である。

【図20】実施形態6を示す概略構成図である。 【符号の説明】

10 電子エミッタ

11 背面ガラス基板

12 バリアリブ

13 蛍光体層

14 アドレス電極

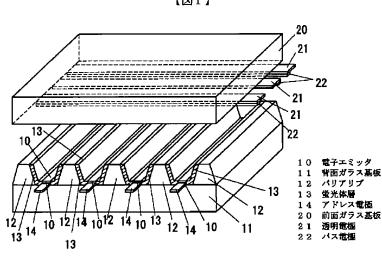
20 前面ガラス基板

21 透明電極

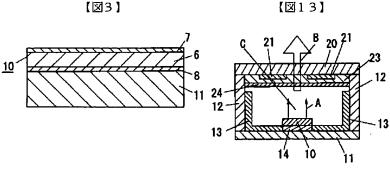
22 バス電極

20

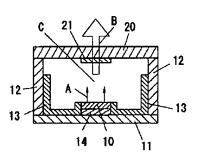
【図1】



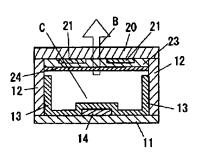
【図13】

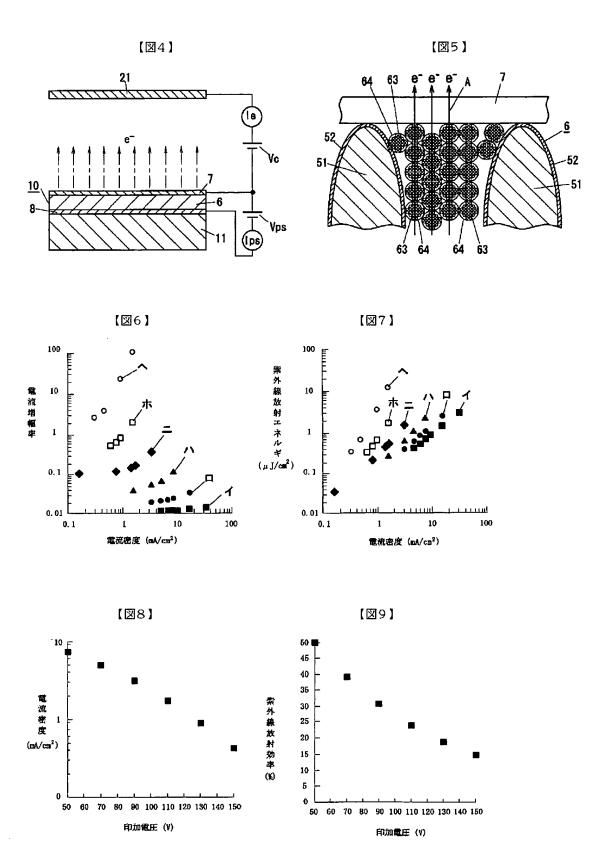


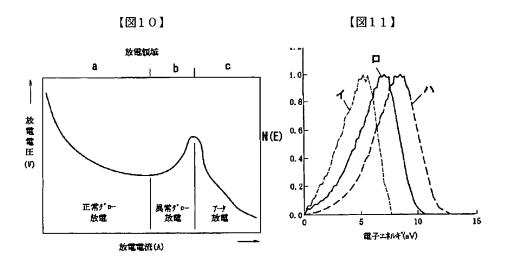
【図2】

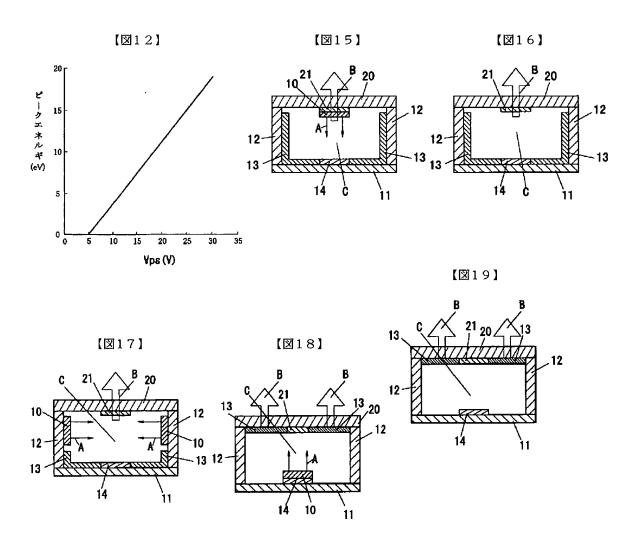


【図14】

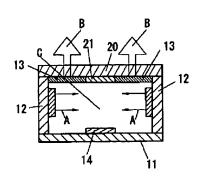








【図20】



フロントページの続き

(72)発明者 相澤 浩一 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株 式会社内

(72)発明者 橘 邦英 京都府京田辺市大住ケ丘4丁目23-12番地 (72)発明者 橋口 征四郎

滋賀県蒲生郡安土町下豊浦1266-14番地 Fターム(参考) 50040 FA02 FA04 GB03 GB12 GB14 MA12